(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2006 年3 月30 日 (30.03.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/033186 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/304, B08B 3/02, 3/08, 3/12, 9/08

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/009331

(22) 国際出願日: 2005 年5 月23 日 (23.05.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-275679 2004 年9 月22 日 (22.09.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): エス・イー・エス株式会社 (S.E.S. CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1980023 東京都青梅市今井３丁目９番１８号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中務 勝吉 (NAKATSUKASA, Katsuyoshi) [JP/JP]; 〒7190302 岡山県浅口郡里庄町新庄金山６０７８番エス・イー・エス株式会社グリーンテクノ工場内 Okayama (JP). 山口 弘 (YAMAGUCHI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒7190302 岡山県浅口郡里庄町新庄金山６０７８番 エス・イー・エス株式会社グリーンテクノ工場内 Okayama (JP). 小笠原 和久 (OGASAWARA, Kazuhisa) [JP/JP]; 〒7190302 岡山県浅口郡里庄町新庄金山６０７８番エス・イー・エス株式会社グリーンテクノ工場内 Okayam (JP). 木澤 浩 (KIZAWA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒7190302 岡山県浅口郡里庄町新庄金山６０７８番エス・イー・エス株式会社グリーンテクノ工場内 Okayam (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人 ウィンテック (WIN TECH PATENT OFFICE); 〒1010045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目６番７号 ウンピン神田ビル４階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

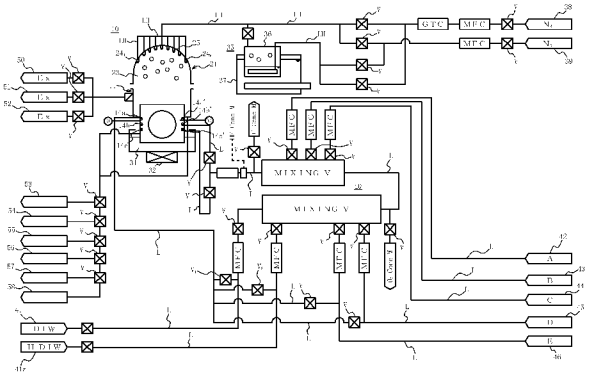
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SUBSTRATE TREATMENT APPARATUS

(54) 発明の名称: 基板処理装置



(57) Abstract: A substrate treatment apparatus, comprising a box-shaped treatment tank (11) having an opening part at its upper side and a cover body (21) openably covering the opening part of the treatment tank. The cover body (21) is characterized in that a drying chamber (23) storing and drying a treated substrate (W) is formed therein, the treatment tank (11) is so formed that at least three of treatment fluid feed nozzle tubes (14a) to (14c) and (14a') to (14c') are disposed at each of the opposed side wall faces thereof forming the box shape horizontally at specified intervals and these feed nozzle tubes (14a) to (14c) and (14a') to (14c') are formed to be connected to a switching mechanism to supply a treatment fluid from the opposed side wall sides while alternately switching them at the opposed side wall faces. Thus, the treatment of various types of chemical liquids, flushing, and drying can be performed in the same treatment tank.

[続葉有]

WO 2006/033186 A1

(57) 要約:

本発明は、上方に開口部を有する箱型の処理槽（１１）と、この処理槽の開口部を開閉自在に覆う蓋体（２１）とを備えた基板処理装置において、前記蓋体（２１）は、その内部に被処理基板（Ｗ）を収容して乾燥する乾燥室（２３）が形成され、前記処理槽（１１）は、前記箱型を構成する対向各側壁面に、それぞれ少なくとも３本の処理液供給ノズル管（１４ａ）～（１４ｃ）、（１４ａ’）～（１４ｃ’）が所定間隔をあけて水平に配設され、これらの供給ノズル管（１４ａ）～（１４ｃ）、（１４ａ’）～（１４ｃ’）は切換機構に接続されて対向する側壁側から交互に切り換えて処理液が供給されるようになっていることを特徴とする。各種の薬液処理、水洗及び乾燥処理を同一の処理槽で処理できるようにした基板処理装置が提供される。